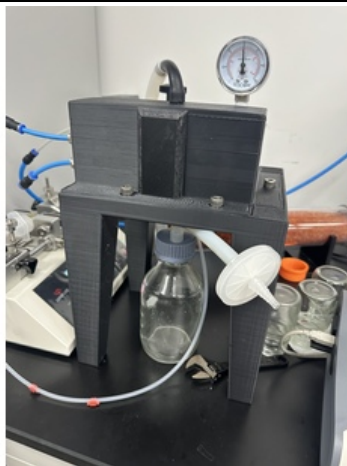


企業名 (設立日)	株式会社K-Nano (2025. 11.)	代表者名	クァク・ドンビン (Kwak Dongbin)
住所	Seoul, Republic of Korea		
URL (動画 : URL)	(調整中)		
製品・サービス名	半導体ウェットプロセスモニタリングの提供		
起業の動機	従来の光散乱モニタは、ナノバブルノイズや不十分なマルチピーク解析により、信頼できる100nm以下の検出が困難であった。その課題を解決し、正確でリアルタイムの液体純度監視を提供したい思いで会社を設立		
製品・サービス紹介	o 製品 :パーティクルジェネレータ <ul style="list-style-type: none">- 当社の粒子発生器は、校正、試験、研究開発用途のために、安定した再現可能なナノ〜サブミクロンエアロゾルを生成するよう設計。- 液滴形成および乾燥条件を精密に制御することで、100nm未満の粒子を安定的に共有し、粒子カウンタ、フィルター、監視システムの性能評価を高精度に実施可能。- 主要機能は、高い安定性と再現性を備え、一貫したテスト結果を得ることができるほか、水・溶媒・化学溶液など柔軟な媒体互換性を有する。- また、コンパクトで使いやすい設計で、ラボ環境と産業環境の双方での利用に適している。		
	o ターゲット市場・規模・将来性 <ul style="list-style-type: none">- 市場規模と成長：半導体プロセス制御市場は、2024年時点で約100〜120億米ドル規模。そのうち、超純水（UPW）、IPA、酸などのウェットプロセスにおける純度モニタリング市場は約20〜30億米ドルに達する。5nm未満の先端ノードや3D NAND／DRAMの拡大が成長を牽引し、今後5年間でCAGR6〜8%成長が見込まれる。- 将来の可能性：リアルタイムのサブ100nm検出に対する需要増により、歩留まりを確保と欠陥低減を実現。将来的には医薬品、ディスプレイ、バッテリー分野への展開も期待される- 市場ニーズ：既存の光散乱ツールは、ナノバブルノイズとマルチピーク限界に直面しており、高感度で信頼性の高いリアルタイムのインライン監視が求められている		
	o 競合優位性、新規性、独自性 <ul style="list-style-type: none">- ナノバブルノイズを克服し、100nm未満の分解能でリアルタイム インライン モニタリングを実現。- 既存の市販のパーティクル カウンターの検出限界を超える性能を有し、高信頼性のサブ100nm粒子計測とリアルタイムのプロセスモニタリングの組み合わせた独自技術が強み。		

製品・サービス
イメージ



<パーティクルジェネレータ>